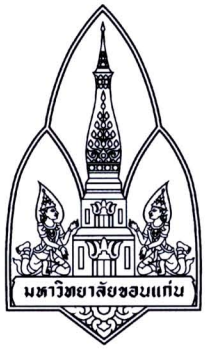
DIELECTRIC PROPERTIES OF NiO-BASED CERAMICS

MR. PRASIT THONGBAI

A THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

KHON KAEN UNIVERSITY

2010



DIELECTRIC PROPERTIES OF NiO-BASED CERAMICS

MR. PRASIT THONGBAI

A THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

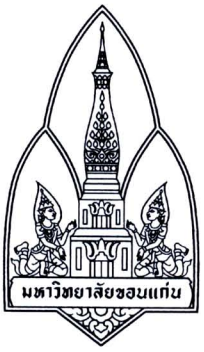
KHON KAEN UNIVERSITY

2010

DIELECTRIC PROPERTIES OF NiO-BASED CERAMICS

MR. PRASIT THONGBAI

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN PHYSICS
GRADUATE SCHOOL KHON KAEN UNIVERSITY
2010



THESIS APPROVAL
KHON KAEN UNIVERSITY
FOR
DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN PHYSICS

Thesis Title: Dielectric Properties of NiO-based Ceramics

Author: Mr. Prasit Thongbai

Thesis Examination Committee

Assoc. Prof. Dr. Vittaya Amornkitbamrung	Chairperson
Assoc. Prof. Dr. Santi Maensiri	Member
Assoc. Prof. Dr. Supon Ananta	Member
Dr. Teerapon Yamwong	Member
Dr. Samuk Pimanpang	Member

Thesis Advisors:

..... Advisor
(Assoc. Prof. Dr. Santi Maensiri)

Teerapon Yamwong ..... Co-Advisor
(Dr. Teerapon Yamwong)

L. Manmart .....
(Assoc. Prof. Dr. Lampang Manmart)
Dean, Graduate School

K. Sangaroon .....
(Asst. Prof. Dr. Kiat Sangaroon)
Dean, Faculty of Science

ประสิทธิ์ ทองใบ. 2553. **สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกกลุ่ม NiO.** วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ,
ดร. ธีระพนธ์ แย้มวงษ์

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพื่อหาจุดกำเนิดของการมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงมากของวัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ (x = 0-0.10 and y = 0-0.15) ที่เตรียมโดยวิธีพอร์ลิเมอร์ไลโรไลซีส ได้ศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึกโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) ส่วนการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์การกระจายพลังงาน (EDS) และได้ศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุเซรามิกในช่วงความถี่และอุณหภูมิต่างๆ

ผลการศึกษาโดยใช้เทคนิค XRD และ SEM-EDS ได้แสดงว่า ปริมาณการเจือของ Li และ Ti มีผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดเฟสและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ผลการทดลองพบว่า ไอออนของ Ti^{4+} ที่ใช้ในการเจือมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกับ NiO เกิดเป็นเฟสเจือปนของ $NiTiO_3$ ในขณะที่ไอออนของ Li^+ สามารถแทนที่ตำแหน่งไอออนของ Ni^{2+} ในโครงข่ายผลึกได้ และยังสามารถช่วยกระตุ้นให้ไอออนของ Ti^{4+} สามารถแทนที่ตำแหน่งของ Ni^{2+} ได้เพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค SEM-EDS ยืนยันได้ว่าอนุภาคของ $NiTiO_3$ มีการสะสมอย่างมากที่ขอบเกรนและผิวหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มปริมาณการเจือไอออนของ Li^+ อนุภาคของ $NiTiO_3$ จะไม่ปรากฏในโครงสร้างทางจุลภาค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้โดยใช้กลไกการเผาผนึกแบบเฟสของเหลว จากการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกพบว่า วัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงมาก โดยมีค่าประมาณ 10^3-10^5 และพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริกมีค่าเพิ่มตามขนาดของเกรนที่เพิ่มขึ้น กระบวนการผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริกที่ความถี่ต่ำ (LFR) และที่ความถี่สูง (HFR) สามารถเกิดขึ้นได้ในวัสดุเซรามิกที่มีปริมาณการเจือไอออนของ Ti^{4+} ที่สูง แต่ปริมาณไอออนของ Li^+ ต่ำ ทั้งกระบวนการ LFR และ HFR สามารถอธิบายได้โดยการประยุกต์แบบจำลองการผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริก Cole-Cole ร่วมกับพจน์ของการนำไฟฟ้ากระแสตรง ผลการศึกษาอิทธิพลของชั้นผิวหน้าของวัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ พบว่าการขัดผิวหน้าของวัสดุเซรามิกได้ส่งผลต่อกระบวนการ LFR แต่ไม่ส่งผลต่อ HFR จากผลการศึกษาด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สามารถพิสูจน์ได้ว่า ชั้นผิวหน้าที่เกิดจากการสะสมของ $NiTiO_3$ มีสมบัติทางไฟฟ้าเป็นฉนวนและส่งผลต่อเนื่องถึงสมบัติทางไดอิเล็กตริกที่ความถี่ต่ำ เมื่อขัดชั้นฉนวนของผิวหน้าออก ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก

จะมีค่าลดลง แต่ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กตริกมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้วยังพบว่า ปริมาณของช่องว่างออกซิเจนในโครงสร้างมีผลอย่างมากต่อกระบวนการ LFR และ HFR หลังจากกระบวนการอบให้ความร้อนภายใต้บรรยากาศอาร์กอนเพื่อเพิ่มปริมาณช่องว่างของออกซิเจนพบว่า ความต้านทานรวมและความต้านทานของเกรนมีค่าเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานดังกล่าวนี้ได้ส่งผลต่อเนื่องถึงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกตัวอย่างเป็นอย่างมากทั้งในช่วงกระบวนการของ LFR และ HFR จากการศึกษาผลของชั้นฉนวนที่ผิวหน้าและการอบให้ความร้อนภายใต้บรรยากาศอาร์กอน แบบจำลองโครงสร้างทางจุลภาคได้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานของการโพลาไรเซชันที่ชั้นฉนวนภายในเพื่ออธิบายสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$

นอกเหนือจากการศึกษาเพื่อหาจุดเริ่มต้นของการมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงมากของวัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ แล้ว ในงานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ที่เตรียมโดยวิธีอื่นๆ และวัสดุเซรามิก NiO กลุ่มอื่นๆ คือ $Li_xV_yNi_{1-x-y}O$ $Li_xFe_yNi_{1-x-y}O$ และ $Li_xAl_yNi_{1-x-y}O$ ผลการทดลองพบว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงมากของวัสดุเซรามิกกลุ่มดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้โดยใช้พื้นฐานของการโพลาไรเซชันที่ชั้นฉนวนภายในที่เกิดขึ้นในวัสดุเซรามิกที่มีโครงสร้างทางจุลภาคไม่สม่ำเสมอ ในงานวิจัยนี้ยังได้เปรียบเทียบสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก $Li_{0.05}Ti_{0.02}Ni_{0.93}O$ กับวัสดุเซรามิก CuO บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงมากเหมือนกับวัสดุเซรามิกกลุ่ม NiO ต่างๆ โดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงมากไม่เกี่ยวข้องสารเจือใดๆ พฤติกรรมทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CuO สามารถอธิบายได้โดยใช้แบบจำลองการผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริกของ Cole-Cole นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของเกรนซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งชี้ถึงการเกิดปรากฏการณ์ตัวเก็บประจุแบบชั้นขวางกั้นภายในในโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิก CuO

Prasit Thongbai. 2010. **Dielectric Properties of NiO-based Ceramics**. Doctor of Philosophy Thesis in Physics, Graduate School, Khon Kaen Unviersity.

Thesis Advisors: Assoc. Prof. Dr. Santi Maensiri,
Dr. Teerapon Yamwong

ABSTRACT

In this research, the origin of the giant dielectric response in $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ceramics (x = 0-0.10 and y = 0-0.15) prepared by a polymer pyrolysis method is investigated. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive x-ray spectrometer (EDS) are used to characterize the phase composition and microstructure, respectively. The dielectric and electrical properties are investigated as functions of frequency and temperature.

The XRD and SEM-DES results demonstrate that the Li and Ti doping concentrations have remarkable influences on both of the phase formation and microstructural evolution of the $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ceramics. It is found that the Ti^{4+} ions prefer to form the second phase of $NiTiO_3$ phase; in contrast, the Li^+ ions prefer to substitute the Ni^{2+} sites in the NiO crystal lattice. Interestingly, Li doping has a large contribution to the substitution of the Ti^{4+} ions on the Ni^{2+} sites. The surface morphologies and microstructure are found to be depended strongly on the Li and Ti doping concentrations. The SEM-EDS results show that the $NiTiO_3$ particles largely accumulate along the grain boundaries and surfaces. Surprisingly, such large accumulation can be erased by increasing the Li doping concentration. The microstructural evolution can suitably be ascribed based on the liquid-phase sintering mechanism. For the dielectric properties, it is revealed that all of the $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ceramics exhibit the giant dielectric constant, $\varepsilon' \sim 10^3$-10^5. ε' of each ceramic composition increases with increasing the grain size. Two sets of relaxations are observed in the dielectric spectra of samples with high-Ti content and relative low-Li content. A low-frequency dielectric relaxation (LFR) is changed with the polishing surface; whereas, a high-frequency relaxation (HFR) remains constant. It can be proved that the $NiTiO_3$ surface layers behave as insulating layers, affecting to the LFR properties—ε' decreases with removing the insulating surfaces accompanied by the

increase in loss tangent. Both of the LFR and HFR can be well fitted by the Cole-Cole relaxation equation combined with the dc conduction term. It is found that the oxygen vacancies show a great influence on both of the LFR and HFR processes. The resistance of the grain of all samples increases with annealing of the samples in Ar. The total resistance of the group of samples that exhibit the LFR is found to be enhanced by the annealing. These changes in the resistances can cause a dramatic change in the dielectric properties in both the LFR and HFR processes. According to the investigation of the surface and annealing effects, two suitably models of the microstructure are proposed based on the interfacial polarization mechanism in order to describe the observed giant dielectric response in the $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ceramics.

Besides the investigation of the origin of the giant dielectric properties of the $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ceramics, the $Li_xTi_yNi_{1-x-y}O$ ceramics with different preparation methods and other NiO-based systems, i.e., (Li, Fe)-, (Li, V)-, and (Li, Al)-doped NiO systems, are also studied in this research. The giant dielectric properties of these ceramic systems can be ascribed based on the interfacial polarization mechanism, resulting from the inhomogeneous structure. Finally, the giant dielectric constant observed in the $Li_{0.05}Ti_{0.02}Ni_{0.93}O$ ceramic is compared to that observed in pure-CuO ceramic. Interestingly, the CuO ceramic can exhibit the giant dielectric properties without any dopants. Moreover, the dielectric relaxation behavior of the CuO ceramic can be ascribed by the Cole-Cole relaxation model just like the $Li_{0.05}Ti_{0.02}Ni_{0.93}O$ ceramic. Furthermore, it is found that the dielectric constant increases with increasing the grain size, suggesting to the internal barrier layer capacitor effect.

Goodness portion of the present thesis is dedicated for my family and all of my teachers

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to express my deepest and sincere gratitude to my supervisor and co–advisor, Assoc. Prof. Dr. Santi Maensiri and Dr. Teerapon Yamwong for their relentless encouragement, constructive guidance and words of motivation throughout the duration of this research study and moreover for the inspiration they provided to ensure the completion of this work. Their expertise, availability to discuss ideas and willingness to give of their knowledge were instrumental. I am grateful to my PhD committee who took effort in reading and providing me with valuable comments: Assoc. Prof. Dr. Vittaya Amornkitbamrung, Assoc. Prof. Dr. Supon Ananta and Dr. Samuk Pimanpang.

I wish to thank the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Thailand for technical support in the dielectric constant and loss measurement. I have furthermore to thank the Department of Physics, Biology, and Chemistry, Faculty of Science at KKU, to use research facilities.

I would also like to express my thanks to my friends for their encouragement and thoughtful criticisms. I am also grateful for the help, assistance and friendship of the past and current students in the Small and Strong Materials Group (SSMG) members which will always be remembered with deep gratitude.

Finally, I would like to thank Ms. Nutthakritta Phromviyo for her great care, help, support and bringing me going through the good and bad times. My special thanks to my "Tongbai" family for the sacrifices they made, to bring me up and give the good life. Without their constant support and encouragement throughout my whole educational life, none of this would have been possible.

This research was supported by grant from The National Science and Technology Development Agency through the Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST) Programs and Graduate School, Khon Kaen University.

Prasit Thongbai

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

TABLE OF CONTENTS (Cont.)

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF FIGURES (Cont.)

LIST OF SYMBOLS

σ'_{s0}	Surface charge density
$\vec{E}$	Electric filed
ε_0	The permittivity of free space (8.854×10^{-12} Fm^{-1})
μ_0	The vacuum permeability
c_0	The speed of light in vacuum
ε_{permit}	The permittivity of a dielectric material
ε'	The dielectric constant
C_0	The capacitance of the free-space capacitor
C	The capacitance
$\vec{\mu}$	The electric dipole moment
$\pm Q$	The electric charges
$\vec{P}$	The polarization
N	The number of the displaced molecules per unit volume
σ'_b	The bound charge density
I_c	The charging current
V	The sinusoidal voltage ($V = V_0 \exp(j\omega t)$)
G	The conductance
I_{total}	The total current
I_l	The loss current
δ	The loss angle
ε^*	The complex dielectric constant
ε'	The real part of ε^* (the dielectric constant)
ε''	The imaginary part of ε^* (the dielectric loss)
ω	The angular frequency
$\tan\delta$	The loss tangent or the dissipation factor
$\vec{D}$	The total electric displacement field
ε^*_{permit}	The complex permittivity of a dielectric material
χ	The electric susceptibility
N_i	The number of dipoles of type i per unit volume
$\overline{\mu}_i$	The average dipole moment
α	The polarizability
E'	The local electric field
E_a	The external applied field
α_e	The electronic polarizability
α_a	The atomic polarizability
α_{or}	The orientational polarizability

LIST OF SYMBOLS (Cont.)

α_{sc}	The space charge polarizability
P_{total}	The total polarization
P_e	The electronic polarization
P_a	The atomic polarization
P_{or}	The orientational polarization
P_∞	The high-frequency polarization
ε'_∞	The dielectric constant at a high frequency range
ε'_s	The low-frequency dielectric constant or the relaxed static dielectric constant
τ	The relaxation time
P'	The probability of a jump
z	The valence of the ion
$P_{s(hopping)}$	The zero-frequency value of the hopping polarization
k_B	The Boltzmann constant (1.38×10^{-23} J/K)
T	The absolute temperature (K)
b	The distance separating the potential well
α	The Cole-Cole constant parameter ($0 < \alpha \leq 1$)
J_{total}	The total current density
J	The conduction current or current density
σ_{dc}	The dc electrical conductivity
σ_{ac}	The ac electrical conductivity
Y^*	The complex admittance
E_a	The activation energy
$f_{p(\varepsilon'')}$	The frequencies at the peak of ε''
$f_{p(\delta)}$	The frequencies at the peak of $\tan\delta$
Z^*	The complex impedance
Z'	The real part of the complex impedance
Z''	The imaginary part of the complex impedance
(R_g, R_{gb})	The resistances of grains and grain boundaries, respectively
(C_g, C_{gb})	The capacitances of grains and grain boundaries, respectively
ε'_{gb}	The dielectric constant of the grain boundary
d_g	The grain size
d_{gb}	The thickness of grain boundary
$\sigma_{polaron}$	The polaron conductivity

LIST OF SYMBOLS (Cont.)

E_g	The activation energy for conduction inside grain
E_{gb}	The activation energy for conduction at grain boundary
$Ti_{Ni}^{\bullet\bullet}$	The Ti ion sitting on the Ni lattice site with two positive charges
V_{Ni}''	The Ni vacancy with double negative charge
ε_g^*	The complex dielectric permittivity of grain
ε_{gb}^*	The complex dielectric permittivity of grain boundary
$Ta_{Ni}^{\bullet\bullet\bullet}$	The Ta ion sitting on the Ni lattice site with three positive charges
Li_{Ni}'	The Li ion sitting on the Ni lattice with a single negative charge
$V_O^{\bullet\bullet}$	The oxygen vacancy with double positive charges
$[V_O^{\bullet\bullet}]$	The concentration of oxygen vacancy
$Ni_i^{\bullet\bullet}$	The Ni ion in the interstitial lattice site
K	The equilibrium constant
X	The reactance
G	The conductance
B	The susceptance
D	The dissipation factor
R	The resistance
C_p	The capacitance of the parallel plate capacitor
F	The structure factor
f	The atomic scattering factor
D	The diffusion coefficient or diffusivity
G_L	The limiting grain size
r	The radius of the including particles
C_s	The capacitance of surface layer
R_s	The resistance of surface layer